

結晶加工と評価技術第 145 委員会 第 107 回研究会

日 時：2006 年 7 月 7 日（金）10：00－17：00

場 所：弘済会館 4F 菊の間

テーマ：フォトリソ用シリコン結晶の加工と評価

世話人：和田一実（東京大学大学院），上浦洋一（岡山大学大学院）

<プログラム>

セッション 1：シリコンフォトリソの現状と将来（座長：上浦洋一）

10:00-10:05 あいさつ

梅野正隆（福井工大）

10:05-10:40 イントロダクトリートーク&創成研究シリコン CMOS フォトリソ

和田一実（東大院）

10:40-11:10 シリコン LSI の将来と光技術

小柳光正、福島誉史、田中徹（東北大院）

11:10-11:40 フォトリソネットワークから見たシリコンフォトリソへの期待

木下進（富士通研）

11:40-12:10 表面プラズモン受光器

大橋啓之，西研一，藤方潤一，石勉，岡本大典，牧田紀久夫（NEC）

12:10-13:30 昼食休憩

セッション 2：フォトリソ・デバイスの現状と将来（座長：和田一実）

13:30-14:00 シリコン細線光導波路 —基本特性とその機能デバイスへの応用—

山田浩治，土澤泰，渡辺俊文，福田浩，篠島弘幸，板橋聖一（NTTマイクロシステムインテグレーション研究所）

14:00-14:30 Er添加SiGeエピ結晶成長

上浦洋一，石山武，山下善文（岡山大院）

14:30-15:00 シリコンフォトリソに向けた希土類シリケートErSiO半導体の開発とその発光特性

木村忠正，一色秀夫（電通大）

15:00-15:30 休憩

セッション 3：フォトリソ関連加工の現状と将来（座長：和田一実）

15:30-16:00 SiおよびSiO₂深掘り構造の形成とそのシリコンフォトリソ分野への応用

勝山俊夫^{1,2}，細見和彦^{1,2,3}，山田宏治¹，五島滋雄^{1,2,3}，荒川泰彦¹
（東大生研¹，（財）光産業技術振興協会²，日立中研³）

16:00-16:30 ガスクラスタライオンビームによるシリコン系材料のナノプレジジョン加工

豊田紀章，山田公（兵庫県大）

16:30-17:00 未定（依頼中）

17:10-18:50 懇親会 桜の間：会費2000円（当日受付にて申し受けます）